연구미팅 초록

이광운

시간: 오후 15시 00분 ~

장소: 전기전자컴퓨터공학부 A동 403호

초록:

지난 미팅을 통해서 eta_s와 eta_omega에서 반경까지 고려한 모델링을 하였다. 2nm에서 오차가 약간 있지만 2nm보다 큰 다른 반경에서 대체로 잘 맞아 들어갔다. 그리고 반경이 작아질 수록 gate voltage가 낮은 구간에서 integrated electron density의 오차가 심해졌던 부분은, 전자의 농도만 고려하고 계산 하였으므로 특정 전압 구간을 잡아서 보기로 하였다. 그래서 미팅 때나온 얘기가 전체 전자 농도와 홀 농도를 계산하여 두 그래프가 겹치는 지점을 기준으로 생각해보는 방법이 있었는데, 처음부터 전자의 농도가 더 높아서 이 방법을 쓸 수 없었다. 2nm의경우 대략 0.35V 정도가 되야 오차가 5% 아래로 떨어져, 특정 구간을 잡지 못하고 있다.

그래서 이 과정에서 잘못된 것이 없나 확인하려, TCAD 결과를 가지고 얻어진 식으로 다시 표면에서의 포텐셜을 구해보았다. 이 경우에도 반지름이 작아질수록 차이가 커졌다. 그러나 매트랩에서 얻어진 식을 가지고 계산했을 때는, 농도에는 오차가 컸지만 표면에서의 포텐셜에는 큰차이가 없었다. 이러한 차이가 생기는 원인을 찾는 중이고, 다시 짚고 넘어 가는 과정이 필요할 것 같다.